

# 机械剥离氧化硅硅基底单层二硫化钼

中文名称： 机械剥离氧化硅硅基底单层二硫化钼

英文名称： Mechanical exfoliation MoS<sub>2</sub> on SiO<sub>2</sub>/Si

货 号： ML1107

CAS 号： 1317-33-5

包 装： 1 片

保质期： 6 月常温干燥避光

性 质

形 态： 薄膜

参 数

**基 底：** 二氧化硅/硅

**氧化层：** 300nm

**基底尺寸：** 10 mmx10 mm

**MOS2 面积：**  $>10 \mu\text{m}^2$

**应 用：** 酶联生物最新推出机械剥离制备的二硫化钼，相比较锂插层制备的单层类石墨烯材料，该类材料具有缺陷少，优异的光学性质，可以研究层数和荧光效应，此外，由于保持了原有晶格结构，所以该类材料是制备器件的理想材料。